



平成 25 年 11 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ダルトン  
代表者名 代表取締役社長 矢澤 英人  
(JASDAQ・コード7432)  
問合せ先 代表取締役副社長 東郷 武  
電話：03-3549-6800

## 中期経営計画の修正およびセグメント変更に関するお知らせ

当社は、2015 中期経営計画の修正および事業セグメントの変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 中期経営計画の修正

当社は、平成 31 年度の創業 80 周年に向けて、平成 25 年度から始まる三ヵ年を前期と捉えて、平成 27 年度を目標年度とした「2015 中期経営計画」を策定しております。その初年度、平成 25 年度の業績が当初計画を大幅に下回る結果となり、「2015 中期経営計画」について、業績計画や各種施策の検証をおこないました。

平成 25 年度計画の作成段階では、官公庁の研究開発関連の予算執行や民間企業における設備投資意欲の回復を期待し、強気の目標設定としましたが、これまでなかったほどに官公庁の年度末需要が伸び悩み、また、民間設備投資の回復意欲も当社業績への影響に時間を要する結果となり、計画未達となりました。

しかしながら、官公庁需要の引合いや民間設備投資に関係する引合いは動き始めております。また、科学研究施設分野における大型新製品を平成 26 年度には市場投入し、粉体機械分野においても大阪の新しい戦略拠点が平成 26 年 1 月に本格稼働するなど、業績拡大への施策は確実に実行されています。

これら内外の環境変化を踏まえ、当社の目指す方向性や施策を変更する必要はないとするものの、初年度の業績落ち込みを 2015 年までに回復することは困難であると判断し、中期経営計画の数値目標は変更せず、その達成年度を一年先送りした、「2016 中期経営計画」として再スタートすることとしました。

#### 2. 事業セグメントの変更

当社は、平成 26 年度組織で事業部組織の変更をおこないましたが、今回の中期経営計画の修正とあわせ、事業セグメントの変更をおこなうこととしました。

事業部組織の変更内容は、システム機器事業部と粉体機械事業部を統合するものであります。目的は、粉体機械技術とアイソレータ、グローブなどのクリーン技術（封じ込めや無菌化）、半導体関連製造装置の洗浄・剥離技術などの要素技術の集約を図り、新しい分野での製品開発の促進や装置化、プラント化に対応できる技術集団を目指すものであります。また、この分野は顧客ニーズに合わせたカスタマイズ対応が必須であり、営業機能を統合することで、顧客ニーズへの迅速かつ幅広い対応をおこない、同分野の事業拡大を目指すものであります。

これを受けた事業セグメントの変更内容は、科学研究施設セグメントから半導体関連製造装置、アイソレータ等の分野を分離し、粉体機械等セグメントに統合するというものであり、セグメント名称を以下の通り変更しました。

旧)		新)
科学研究施設セグメント	⇒	施設機器セグメント
粉体機械等セグメント	⇒	機械装置セグメント

なお、事業セグメントの組換えによる業績推移は次の通り。

単位)百万円		売上高	セグメント利益	本社調整費	営業利益
2009年度	施設機器	9,977	185(1.9%)	—	—
	機械装置	5,724	314(9.4%)	—	—
	全社合計	15,710	499(3.2%)	-438(2.8%)	61(0.4%)
2010年度	施設機器	10,741	534(5.0%)	—	—
	機械装置	4,761	313(6.6%)	—	—
	全社合計	15,502	847(5.5%)	-427(2.7%)	420(2.7%)
2011年度	施設機器	9,749	174(1.8%)	—	—
	機械装置	6,288	660(10.5%)	—	—
	全社合計	16,037	834(5.2%)	-402(2.5%)	432(2.7%)
2012年度	施設機器	10,054	246(2.4%)	—	—
	機械装置	7,239	666(9.2%)	—	—
	全社合計	17,293	912(5.3%)	-495(2.9%)	417(2.4%)
2013年度	施設機器	9,515	194(2.0%)	—	—
	機械装置	5,644	384(6.8%)	—	—
	全社合計	15,160	578(3.8%)	-493(3.3%)	85(0.6%)
【ご参考】 5ヶ年平均	施設機器	10,007	267(2.7%)	—	—
	機械装置	5,933	467(7.9%)	—	—
	全社合計	15,941	734(4.6%)	-451(2.8%)	283(1.8%)

### 3. 「2016 中期経営計画」の施策（変更なし）

前述の通り、「2016 中期経営計画」として当社の目指すべき方向性、施策に変更はありません。

#### 【メインテーマ】

インフラ整備による成長基盤、収益基盤の再構築

～ 環境変化に強い事業ポートフォリオの構築とグループ経営コストの削減 ～

#### 【具体的テーマ】

##### 1) 主力分野の強化

- ① コアである研究施設機器分野の利益率向上、安定成長
- ② サブ事業である粉体機械分野の売上高拡大、育成強化

##### 2) 周辺分野の育成

- ① 施設機器メンテナンス分野の育成
- ② アイソレータ分野の育成
- ③ 液処理分野の育成
- ④ 粉体受託加工分野の育成

##### 3) 新規分野の開拓

- ① 半導体関連製造装置等の市場開拓、新製品開発
- ② 製造子会社によるグループ外OEMへの取り組み

##### 4) ブランディングおよびプロモーション強化

各社の個性を活かしつつ、グループとして一体感、躍動感ある事業展開を強化

【連結数値目標】

単位)百万円		売上高	セグメント利益	本社調整費	営業利益
2016年度目標	施設機器	12,800	640(5.0%)	—	—
	機械装置	8,800	730(8.3%)	—	—
	全社合計	21,600	1,370(6.3%)	-500(2.3%)	870(4.0%)
【ご参考】 2014年度目標	全社合計	18,100	—	—	500(2.8%)

注) 本社調整費：総務経理部門等の管理部門に係る費用及び全社的役員に関する人件費などの全社的費用

4. 創業80周年経営構想【ご参考】

連結数値に変更はありませんが、セグメント別の売上目標を組み替えております。

【業績目標】

連結売上高：300億円（施設機器セグメント：170億円、機械装置セグメント：130億円）

営業利益額：20億円、営業利益率：6.7%

本資料に含まれる将来の計画数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報および仮定に基づいており、実際の業績は様々な要因により計画と異なる場合があります。

以上